

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2025 年 7 月 3 日 (03.07.2025)



(10) 国际公布号
WO 2025/138465 A1

(51) 国际专利分类号:
G01N 21/88 (2006.01) **G01N 21/952** (2006.01)
G01N 21/95 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2024/083760

(22) 国际申请日: 2024 年 3 月 26 日 (26.03.2024)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202311836488.7 2023 年 12 月 27 日 (27.12.2023) CN

(71) 申请人: 上海御微半导体技术有限公司 (SHANGHAI YUWEI SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD) [CN/CN]; 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 10 幢 1-4 层 01 室 201208 (CN)。

(72) 发明人: 田依杉 (TIAN, Yishan); 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 10 幢 1-4 层 01 室 201208 (CN)。 兰艳平 (LAN, Yanping); 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 10 幢 1-4 层 01 室 201208 (CN)。 尹光才 (YIN, Guangcai); 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 10 幢 1-4 层 01 室 201208 (CN)。 孔寒夫 (KONG, Hanfu); 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 10 幢 1-4 层 01 室 201208 (CN)。

(74) 代理人: 北京品源专利代理有限公司 (BEYOND ATTORNEYS AT LAW); 中国北京市海淀区莲花池东路 39 号西金大厦 6 层 100036 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,

(54) Title: DEFECT DETECTION SYSTEM, METHOD AND APPARATUS, DEVICE, AND STORAGE MEDIUM

(54) 发明名称: 缺陷检测系统、方法、装置、设备及存储介质

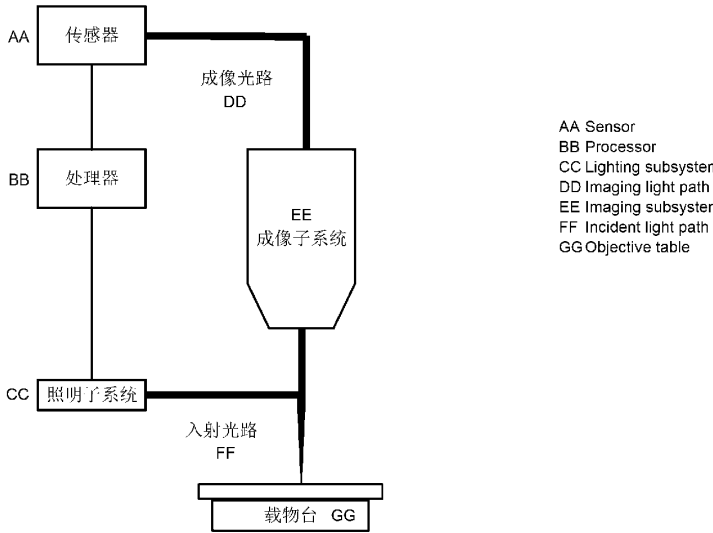


图 1

(57) Abstract: A defect detection system, method and apparatus, a device, and a storage medium. The system comprises an objective table, a lighting subsystem, an imaging subsystem, a sensor and a processor. The lighting subsystem is connected to the processor, and the sensor is connected to the processor. The imaging subsystem is arranged on the objective table and is used for imaging an object to be inspected placed on the objective table. The lighting subsystem is arranged in an incident light path of the imaging subsystem, and the sensor is arranged in an imaging light path of the imaging subsystem. A target area of said object is located in an illumination area of the lighting subsystem.

[见续页]

CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要: 一种缺陷检测系统、方法、装置、设备及存储介质。该系统包括: 载物台、照明子系统、成像子系统、传感器及处理器; 所述照明子系统与所述处理器相连, 并且所述传感器与所述处理器相连; 所述成像子系统设置于所述载物台之上, 用于对放置于所述载物台上的被检测物体进行成像; 所述照明子系统设置于所述成像子系统的入射光路上, 所述传感器设置于所述成像子系统的成像光路上; 所述被检测物体中的目标区域位于所述照明子系统的照射区域中。